

# 顯影液過濾及液體分離系統

Developer Separate System

- 可分離各種液體
- 分子量處理範圍 500~10,000
- 提升良率，維持顯影液濃度穩定
- 節省成本，大幅降低顯影液消耗
- 提升產速，減少保養週期與工時
- 節省大量用水及排水，降低廠務負擔
- 自動清洗，濃度管理，使用效果及壽命有保障
- 可擴充各種功能滿足生產條件
- 處理量 1~100 CMH
- 此系統已榮獲 4 國專利



## \* KOH 顯影液

|                             | 過濾前   | 過濾後   |
|-----------------------------|-------|-------|
|                             |       |       |
| 導電度 $\mu\text{S}/\text{cm}$ | 2277  | 2856  |
| PH值(ph)                     | 10.39 | 10.38 |
| 總溶解固體TDS(ppm)               | 1428  | 1138  |

## \* NaOH 顯影液

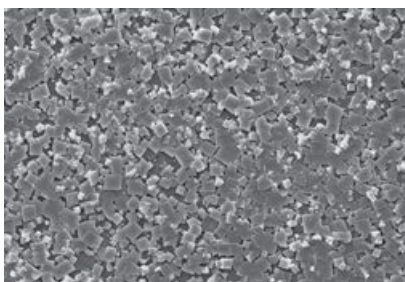
|                             | 過濾前   | 過濾後   |
|-----------------------------|-------|-------|
|                             |       |       |
| 導電度 $\mu\text{S}/\text{cm}$ | 3860  | 3446  |
| PH值(ph)                     | 10.43 | 10.40 |
| 總溶解固體TDS(ppm)               | 1932  | 1728  |

## \* $\text{Na}_2\text{CO}_3$ 顯影液

|                             | 過濾前   | HP濾芯  | UHP濾芯 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|
|                             |       |       |       |
| 導電度 $\mu\text{S}/\text{cm}$ | 14970 | 14770 | 14580 |
| PH值(ph)                     | 11.01 | 11.01 | 11.01 |
| 總溶解固體TDS(ppm)               | 7480  | 7380  | 7290  |

## \* 半導體化學研磨廢液(CMP)

|                | 過濾前  | 過濾後   |
|----------------|------|-------|
|                |      |       |
| 砷(As)含量(mg/kg) | 1260 | 661   |
| 鎵(Ga)含量(mg/kg) | 691  | 0     |
| 固含量(mg/g)      | 2.94 | 0.792 |



化學膜入水面  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  的結晶



操作介面



系統配置